



第六届全国磁性薄膜与纳米磁学会议在宁波召开

文章来源: 宁波材料技术与工程研究所

发布时间: 2010-06-09

【字号: 小 中 大】

由中国物理学会磁学专业委员会、中国电子学会应用磁学分会主办,中国科学院宁波材料技术与工程研究所、宁波市科技局承办的“第六届全国磁性薄膜与纳米磁学会议”于6月1日至4日在宁波市金港大酒店顺利召开。杨应昌院士、都有为院士、王鼎盛院士、张裕恒院士、詹文山研究员、沈保根研究员、金晓锋教授以及来自全国各地的200多名磁学专家、学者参加了此次会议。

宁波材料所党委书记、副所长严庆致开幕辞,对与会代表表示欢迎;都有为院士、张裕恒院士、詹文山研究员等人就自旋电子学及其产业化做了报告,深入剖析了自旋电子学的发展史、存在的关键问题、产业化的现状等,引起了与会学者浓厚兴趣与热烈讨论。此次会议就磁电阻与自旋电子学、磁性薄膜、异质结、多层膜、颗粒膜、超薄膜、纳米晶软磁、永磁、纳米复合磁性材料、低维磁性、量子磁性、基础磁学和纳米磁学等多个方向进行了深入的探讨和交流。在本次会议中,各位与会代表都介绍了各自的最新研究成果,展示了我国在磁性薄膜与纳米磁学领域的蓬勃发展与生机。本次会议不仅在学术方面进行了交流,很多与会代表对磁电阻材料、复合磁性薄膜材料的产业化应用也进行了深入的探讨,展示了我国磁性材料领域产学研结合发展趋势。本次会议开的圆满成功,大家共同分享了前沿的科研信息,增进了全国磁学专家和学者的交流,共同探讨了磁学领域的一些关键问题。

本次会议共设有一个主会场、大会邀请报告5个;根据磁学不同的研究方向,设有三个分会场、分会邀请报告25个、分会报告95个,与会代表们进行了深入的交流探讨。会后,与会代表们还参观了宁波材料所。



严庆所长致开幕辞



王鼎盛院士主持大会



都有为院士做大会报告



张裕恒院士做大会报告



詹文山研究员做大会报告



会议现场

[打印本页](#)

[关闭本页](#)

© 1996 - 2010 中国科学院 版权所有 备案序号：京ICP备05002857号 联系我们

地址：北京市三里河路52号 邮编：100864